

PLASUS GmbH

Prozessplasmen voll im Griff

Die PLASUS GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von spektroskopischen Plasma-monitor- und Prozesskontrollsystemen für jegliche Art von Plasmaprozessen in FuE und Industrie. Seit 1996 entwickelt, produziert und vertreibt PLASUS innovative und anwendungsorientierte Plasmamonitor- und Prozesskontrollsysteme. Die Anwendungen reichen von der Qualitätskontrolle von PECVD- und atmosphärischen Plasmen über die Endpunktdetektion bei Ätzprozessen bis hin zur Regelung von reaktiven Sputterprozessen.

Der Firmengründer Dr. Thomas Schütte legte von Beginn an besonderen Wert auf die passgenaue Anwendung der spektroskopischen Messtechnik in schlüsselfertigen Systemen für industrielle Plasmaprozesse. In einer umfassenden Bedienoberfläche wird die automatisierte Messdatenanalyse konfiguriert. Im Betrieb werden dann die Messdaten auf prozessrelevante Parameter reduziert und für die Prozesskontrolle und -regelung bereitgestellt. Das Ergebnis sind modernste Plasmamonitor- und Prozesssteuerungssysteme, die die Entwicklung innovativer Echtzeit-Messverfahren in der Plasmatechnik ermöglichen.

Produkte

Die modular konfigurierbaren EMICON-Systeme können mit allen notwendigen Eigenschaften ausgerüstet werden, um technische Prozessplasmen für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen zu beobachten, zu analysieren und zu regeln.

Die Spektrometereinheiten der EMICON-Systeme decken den UV-VIS-NIR-Bereich ab und erfassen damit alle prozessrelevanten Spezies in typischen industriellen Plasmaverfahren. Verschiedene Zusatzmodule erlauben es, das System an spezifische Anwendungsfälle anzupassen.

PLASUS bietet eine große Vielzahl von Optikkomponenten für den Einsatz im und außerhalb des Vakuums an, um die gesamte optische Messstrecke abzudecken.



PLASUS SPECLINE ist ein leistungsstarkes Softwarepaket zur Spektraldaten-Auswertung. Die weltweit einzigartige Datenbank für Atome und Moleküle kombiniert mit einer leistungsstarken Nutzeroberfläche ist ein unentbehrliches Werkzeug für die Analyse und Interpretation der Messdaten.

Entwicklungen

Die neueste Generation der EMICON-Systeme wird eine deutlich bessere zeitliche Auflösung der Spektralmessung ermöglichen. Damit eröffnet sich insbesondere die Möglichkeit, gepulste Prozesse zeitlich aufzulösen.

Daneben erweitern wir unser Methodenportfolio durch photometrische in-situ Messtechnik. Dies bietet für Oberflächenprozesse die Option, Schichteigenschaften wie Reflexion, Transmission, Schichtdicke oder Farbe in-situ zu bestimmen.

Kompetenzen

Ein engagiertes Team aus erfahrenen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Softwareentwicklern konzipiert und konstruiert die PLASUS Messsysteme, in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerunternehmen.

Die Softwareentwicklung ist eine der Kernkompetenzen von PLASUS. Alle Software-Produkte werden im eigenen Haus entwickelt und kodiert, was eine nahtlose Anbindung an die Hardware-Komponenten garantiert. Kunden- und Marktanforderungen können so flexibel umgesetzt werden.

Durch die mehr als 25-jährige Beschäftigung mit industriellen Plasmaprozessen in den verschiedensten Anwendungen verfügt die PLASUS GmbH über einen breiten Erfahrungsschatz in diesem Bereich. Sie ist daher ein nachgefragter Partner für Entwicklungsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene und verfügt über ein großes Netzwerk im Industrie- und FuE-Bereich. Aus diesen Projekten mit führenden Industriekunden und renommierten Forschungsinstituten ergeben sich wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unserer Messsysteme.

PLASUS

Leistungsfelder

Spektroskopische Analyse von Plasmaprozessen, Plasmamonitoring, Prozessüberwachung u. -regelung, Qualitätssicherung, Industrie 4.0

Kontakt

PLASUS GmbH
Lechstraße 9, 86415 Mering
www.plasus.de, service@plasus.de
Tel.: 08233 7353 78-0